

Porte-Wafers Circulaire Ptfé De 6 Pouces Résistant Aux Acides Et Aux Alcalins Pour Le Nettoyage De Semi-Conducteurs, Panier Fleur Personnalisable

Numéro d'article: PL-CP55



Introduction

Porte-wafers PTFE de 6 pouces à haute pureté conçus pour les procédés humides critiques de semi-conducteurs. Conçus pour une résistance chimique extrême et une stabilité thermique, ces paniers fleur personnalisables assurent un nettoyage uniforme et une protection des substrats dans des environnements d'immersion acides et alcalins harsh tout au long de la production.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Nettoyage RCA de semi-conducteurs	Immersion des wafers dans des solutions SC-1 et SC-2 pour éliminer les contaminants organiques et ioniques.	Résistance totale aux agents oxydants et aux bases à haute température.
Procédés de gravure humide	Retrait sélectif de couches de matériaux en utilisant de l'acide fluorhydrique (HF) ou de l'acide phosphorique.	Le positionnement précis du substrat assure une profondeur de gravure uniforme sur le wafer.
Décapage photolithographique	Retrait des couches de résine photosensible en utilisant des solvants organiques agressifs ou des solutions piranha.	Le matériau ne gonflera pas et ne se dégradera pas lorsqu'il est exposé à des solvants harsh.
Texturation de cellules solaires	Nettoyage à grand volume et texturation de surface des wafers de silicium pour une efficacité améliorée.	La conception durable résiste aux rigueurs du débit chimique à l'échelle industrielle.
Rinçage post-CMP	Retrait des particules de boue et des produits chimiques après le polissage mécano-chimique.	Les surfaces ultra-lisses empêchent la ré-attachement des particules et facilitent un rinçage facile.
Préparation pour analyse de traces	Nettoyage de composants de laboratoire à haute pureté dans de l'acide nitrique ou chlorhydrique concentré.	Élimine les risques de contamination croisée pour l'analyse élémentaire à ultra-traces.
Fabrication MEMS	Manipulation de substrats spécialisée pour la production de systèmes micro-électromécaniques.	Les dimensions de fentes personnalisables accommodent les épaisseurs de substrats non standard.

Paramètre	Spécification pour PL-CP55
Identification du produit	Porte-wafers circulaire PL-CP55 (Panier fleur)
Composition du matériau	Polytétrafluoroéthylène (PTFE) vierge à haute pureté
Compatibilité de taille de wafer	6 pouces (150 mm) Standard (Tailles personnalisées disponibles)
Configuration	Panier circulaire à fentes / Conception fleur perforée
Nombre de fentes / Capacité	Personnalisable (Options standard : 10, 25 ou 50 fentes)
Température de fonctionnement	-200 °C à +260 °C (-328 °F à +500 °F)
Résistance chimique	pH 0-14 (Résistance universelle aux acides/alcalis/solvants)

Application	Description	Avantage clé
Paramètre	Spécification pour PL-CP55	
Largeur de fente / Pas	Entièrement personnalisable selon les spécifications de l'utilisateur	
Type de poignée	Poignée fixe intégrée ou poignée oscillante PTFE détachable (Personnalisable)	
Finition de surface	Usinée CNC lisse ($Ra \leq 0,8 \mu m$ typique)	
Méthode de fabrication	100 % usiné par CNC de précision (Produit personnalisé)	
Dimensions	Conçues sur mesure pour s'adapter aux dimensions spécifiques du wet bench ou du réservoir	